PRODUCTION OF FOAM FOR CMP PAD

Patent Number:

JP9132661

Publication date:

1997-05-20

Inventor(s):

YAMADA MITSUO;; OIKAWA SHUNJI;; MIKAMI YOSHIKATSU

Applicant(s):

HITACHI CHEM CO LTD

Requested Patent:

☐ JP9132661

Application Number: JP19950289442 19951108

Priority Number(s):

IPC Classification:

C08J9/06

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a foam used for a CMP pad and having excellent water resistance and consequent durability by forming a mixture comprising a crosslinking agent, a heat-decomposable blowing agent and a polyolefin resin containing an abrasive into a sheet and crosslinking and foaming this

SOLUTION: A crosslinking agent, a crosslinking aid (A), a heatdecomposable blowing agent (B), an abrasive (C) and a polyolefin resin (D) are melt-kneaded at the decomposition temperature of component B or below, and the resultant mixture is formed into a sheet, This sheet is crosslinked and foamed to form a foam for a CMP(chemical-mechanical polishing) pad. Examples of component D include polypropylene and polyethylene, An example of component A is thutylcumyl peroxide. An example of component B is an organic type such as azodicarbonamide or an inorganic type such as sodium carbonate/citric acid mixture. The composition of a combination of component A with component B is desirably such that cell diameters of several tens&mu m or below can be realized. Component C used is desirably a finely divided silicon oxide abrasive, This foam has excellent water resistance as compared with a conventional urethane foam, so that it can give a CMP pad having durability.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

and the second of the second o

en de la companya de

 $\frac{d}{dt} = \frac{dt}{dt} + \frac{dt}$

Experience to the second of th

はない。 Manager Manager

The Control of the Co

は、「ALANDA ALANDA ALANDA AMARA AMAR MASSA ATA AMARA AMARAN ALANDA AMARAN AMARAN

The second secon

And the second of the second o

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-132661

(43)公開日 平成9年(1997)5月20日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

C 0 8 J 9/06 // C08L 23:02

CES

C 0 8 J 9/06

CES

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 3 頁)

(21)出願番号

(22)山原日

特願平7-289442

平成7年(1995)11月8日

(71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72) 発明者 山田 三男

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成

工業株式会社下館研究所内

(72)発明者 及川 俊司

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 日立

化成工業株式会社内

(72) 発明者 三上 喜勝

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 日立

化成工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 若林 邦彦

(54) 【発明の名称】 СMPパッド用発泡体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 耐水性、耐久性に優れたCMPパッドを提供 すること

【解決手段】 架橋剤及び または架橋助剤、熱分解型 **発泡剤、研磨材を含むボリオレフィン系樹脂組成物をシ** ート状に成形し、該シート状成形物を架橋、発泡して得 るCMP (Chemical Mechanical Polishing) バッド 用発泡体を製造する

【特許請求の範囲】

【請求項1】架橋剤及び または架橋助剤、熱分解型発泡剤、研磨材を含むボリオレフィン系樹脂組成物をシート状に成形し、該シート状成形物を架橋、発泡して得るCMP (Chemical Mechanical Polishing) パッド用発泡体の製造方法。

【請求項2】ホリオレフィン系樹脂が、ボリブロビレン、ボリエチレンであることを特徴とする請求項1記載の○MPハッド用発泡体の製造方法。

【請求項3】研磨材料が、シリカであることを特徴とする請求項1記載のCMPバッド用発泡体の製造方法。 【発明の詳細な説明】。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、、CMPバッド用発 泡体の製造方法に関する。

[OOOO2], and the second second second

【従来の技術】にMPパッドは、従来、数十ヵm径の中空部が形成された発泡ポリウレタンが用いられている(月刊 Semi conductor World 1995.5月号。P37)。しかし、ボリウレタンは、一般的には、耐水性に劣るためパッドの耐久性に問題がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記の欠点を改良し耐久性に優れたCMPバッドを提供することにある。

【課題を解決するための手段】かくして、本発明によれは、架橋剤及び、または架橋助剤、熱分解型発泡剤、研磨材を含むボリオレフィン系樹脂組成物をシート状に成形し、該シート状成形物を架橋、発泡して得られるCM P/バッド用発泡体が提供される。

[0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明で用いるボリオレフィン系樹脂は、ボ峡プロピレ ン、ボリエチレン等の樹脂が用vjられる。ポリプロピレ ンとしては、ホモポリプロピレン、プロピレン。エチレ ンプロック共重合体、プロビレンーエチレンランダム共 重台体、リアクターボリオレフィン系熱可塑性エストラー マー(P. E. R)〔ポリプロピレン成分5~45重量 %、エチレン/プロピレン共重合成分95~55重量% からなる工等のボリプロピレンが用いられる。また、ボー リエチレンとしては、低密度ポリエチレン、線状低密度 ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレ ン等のボリエチレンか用いられ、さらにエチレンとαオ レフィンとの共重合体やエチレンと他のモノマー、例え は酢酸ビニル、エチルアクリレート等との共重合体も用 いることができる。本発明において、これらの樹脂は、 単独もしくは、混合物として用いることができる。

【〇〇〇6】本発明におけるこれらのボリオレフィン樹脂には、架橋剤及び または架橋助剤、発泡剤、研磨

材、および必要に応じ他の各種添加剤を加えることがで **ス

【〇〇〇7】本発明に用いる架橋削としては、例えば、 エーブチルクミルバーオキサイド、2,5ジメチルー 2,5ジ(セーブチルバーオキシ)へキサン、2,5ジ メチルー2、5ジ(セーブチルパーオキシ)へキシンー 3等を用いることができ、添加割合は、樹脂成かの合計 量に対して、0,2~5重量部である。この割合が、 0,2重量部未満であると架橋が不十分で均一発泡体が 得られず、5重量部を越えると架橋密度が上がり過ぎ、 発泡体に耳割れ、気泡粗大等が起こり、良好な発泡体が 得られない。

【0008】架橋助剤としては、キノンジオキシム、トリアリルトリメリレート、トリメチロールプロバントリスタクリレート、トリメチロールプロパントリアクリーニュレート、エチレングリコールメ名クリレート等を挙げることができる。これらの架橋助剤の添加割合は、所望の架橋度合い等に応じて適宜定めることができるが、樹脂成分の合計量100重量部に対して、通常の、コー5重量部の範囲が好ましい。

【0009】本発明で使用する熱分解型発泡剤とは、加熱時に分解して気体を発生する化合物で、例えば、アゾジカルボンアミド、ベンセンスルホニルヒドラシド、ジニトロソペンタメチレンテトラミン、トルエンスホニルヒドラジド等の有機系化合物や、炭酸ソーダークエン酸、混合系等の無機化合物が用いられる。これらの発泡剤の中でも特に発泡体が、数十ヵm以下気泡径を与える発泡が好ましい。該熱分解型発泡剤の添加量は、所望の発泡倍率に応じて適宜定めることができるが、樹脂成分の合計量100重量部に対して、2~50重量部、好ましくは5~40重量部の範囲内で使用される。

【0010】本発明で使用する研磨材としては、研磨対象であるプラズマCVD-SiO.膜、CVD-TEOS(テトラエトキシシラン)膜、SOG(スピンオングラス)膜等の薄膜層(月刊SemiconductorWorld 1995.2月号、P76参照)を目的の程度に応じて研磨できれば、特に制限するものではないが、微粒子からなる研磨材、例えば数μm~数十μmの大きさからなる酸化ケイ素を主体とした研磨材等を用いることができる。該研磨材の樹脂100重量部に対する添加量は特に限定しないが、一般的には、5~100重量部で、好ましくは、110~80重量部である。

【 O O 1 1 】本発明においては、必要に応じて各種添加 剤、例えば、酸化防止剤、紫外線吸収剤、重合調整剤、 整泡剤、帯電防止剤、顔料、充填材等を加えることがで きる。

【0012】以上の材料の混合法としては、ホリオレフィン系樹脂、架橋剤及び/または架橋助剤、発泡剤、研磨材、及び所望の各種添加剤を、架橋剤の分解温度または発泡剤の分解温度未満で、バンバリーミキサー、ロー

ル、押出機(単軸、多軸)等を用いて溶融混練し、最終的にはプレス、ダイス等をに介してシート状に成形される。

【0013】なお、得られた架橋発泡体のゲル分率は、20~80%となるように架橋剤、架橋助剤等の添加剤量等を調整することが好ましい。ゲル分率が過小であると耐熱性を得ることができず、逆に過大であると伸び率が低下し耳割れ、フクレ等の外観不良が生じ好ましてない。また、本発明においては、電子線等の放射線を用いて架橋ボリオレフィン系樹脂の架橋を行うことができ、この場合、上記の架橋助剤を用いることができる。電子線の照射量は、樹脂架橋部のゲル率が、20~80%となれば、特に限定しないが、一般的にほゴ~20 Mrad照射され、好ましくは2~10 Mrad 照射される。

【 0 0 1 4 】 木発明による発泡体は、架橋剤及び または架橋助剤、熱分解型発泡剤を含むボリオレフィン系樹脂組成物を、架橋、発泡して得られるボリオレフィン系樹脂発泡体からなり、耐水性に優れ、ひいては耐久性のあるC MP発泡体を提供することができる。

[0015]

スクリュー:圧縮比:3.0

L D: 26

スクリュー回転数 : 45 г р m

シリンダー温度 : C1/C2/C3/C4 ;450/155/155/155 °C

アダプター温度 : AD: 155°C ダイス温度 : D : 155°C

次に、該方法によって得られたシート2 Mrad の電子線 照射に供した後、250℃のオープンに入れ加熱した結 果、発泡倍率約10倍で、フタレ等がない外観良好な発 泡体を得た。

【0017】実施例2

エチレン成分が7重量%、スルトフローレート(MER:230℃)が3g 10分、融点が138℃のエチレン プロピレンランダム共重合体が80重量部と、低密度ボリエチレン 高密度ボリエチレンの混合重量比が70:30のポリエチレン30重量部からなるボリオレフィン系樹脂に、発泡剤としてアゾジカルボンアミドを

スクリュー:圧縮比:3.0 し D:26

スクリュー回転数 : 45 r p m

シリンダー温度 : C1/C2/C3/C4 : 145/150/150/150 ℃

アダプター温度 : AD:150°C

タイス温度 : D : 150°C

次に、該方法によって得られたシート2 Mrad の電子線 照射に供した後、230 Cのオープンに入れ加熱した結果、発泡倍率約10倍で、プラレ等がない外観良好な発 泡体を得た。

[0018]

□ 【発明の効果】本発明によれば「従来のウレタン発泡体」からなるでMPハッド用発泡体に指す、耐水性に優れ、□ 結果として耐久性に優れるCMPバッドを提供すること

【実施例】以下、本発明について、実施例を挙げて説明 するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでは ない

【0016】実施例1

エチレン成分が7重量%、メルトフローレート(ME R:230C)が3g 10分、融点が138Cのエチレン プロビレンランダム共重合体が100重量部に、発泡剤としてアゾジカルボンアミドを5重量部、架橋助剤としてトリメチロールプロパントリアクリレート1重量部、酸化防止剤としてイルガノックス1010を0.5重量部、研磨材として粒径5~20μmのAerosil(日本アエロジル社製)20重量部となるように配合し、してM混練装置を用いて155Cで一括混練した一後、外径約6mmのペレットを作製した。因に、押出量は、65kg hであった。次に、該方法によって得られたペレットを、スクリュー径65mmの単軸押出機のホッパーに投入し、シートダイを用いて厚み約1mmで樹脂及び発泡剤の分散性が良好なシートを成形した(成形条件は下記の通り)。

7重量部、架橋助剤としてトリイチロールプロバントリ

るように配合し、LCM混練装置を用いて155℃で一

括混練した後、外径約6mmのペレットを作製した。因

に、押出量は、70kg hであった。次に、該方法によって得られたペレットを、スクリュー径65mmの単

軸押出機のホッパーに投入し、シートダイを用いて厚み

約O.Smmで樹脂及び発泡剤の分散性が良好なシート

を成形した(成形条件は下記の通り)。

1.1

- アクリレート1重量部、酸化防止剤としてイルガノック

ス1010を0.5重量部、研磨材として粒径5~20 μmのAerosil(日本アエロジル社製)20重量部とな

Tall to the second

 $K(G) = \{ (1, 1, \dots, n) \mid (1, 1, \dots, n) \in \mathbb{N} \mid (1, 1, \dots, n) \in \mathbb{N} \}$

Space Annal Control of the Ann



ed, is the minority of known, and it to put of the following one and in this control to the Million is usually granules; all the milkers of a standing with a consequence of the control o

A Comparison of the control of the c

(40)